超高真空走査トンネルポテンショメトリー法の開発(III)

Development of ultrahigh vacuum scanning tunneling potentiometry (UHV-STP)(III)

○浜田雅之¹、長谷川幸雄¹(1. 東大物性研)

°Masayuki Hamada ¹, Yukio Hasegawa ¹ (1. Inst. for Solid State Phys., Univ. of Tokyo.)

E-mail: mahamada@issp.u-tokyo.ac.jp

走査トンネルポテンショメトリー (STP: scanning tunneling potentiometry) とは、試料表面に 平行に電流が流れている領域の電位分布を、走査ト ンネル顕微鏡(STM)によるトポグラフ像と同時 に描き出す手法で、ナノメートルレベルの高い空間 分解能とμ V レベルという極めて高い電位分解能 を有している。そのため、この手法は、ナノからメ ゾスコピックスケールにおける電気伝導のメカニ ズムを探る有効な手段の一つと言える。しかし、S TMをベースとした手法でありながら、その空間分 解能を存分に発揮できるような表面、例えば、清浄 表面上での異種元素の吸着により誘起される超周 期構造の中で、金属的な性質を持つ系に対しての測定 はあまり行われていない。通常のSTM装置では、超 高真空(UHV)中で作成した超周期構造を壊さずに 表面上に2つの電極を作成するのが困難なためか、S TP測定例は非常に少ない。我々は、これまでに、大 気中(低真空)動作型のSPM装置に、バンドギャッ プを持つ非金属試料の電位分布も測定可能な新しいS TP測定機構を導入することに成功した(Figs.1, 2,

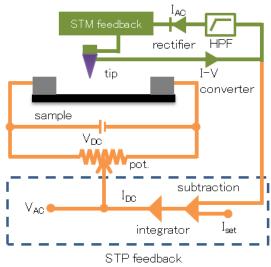


Fig. 1 schematic of STP

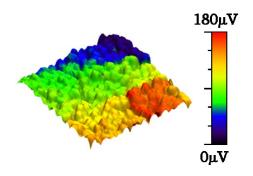


Fig. 2 potential mapping of Au thin film

[1])が、この装置では、超周期構造の作製やその表面上でのSTP測定を行うことはできない。 そこで、表面科学分野で興味が持たれる超周期構造上でのSTP測定を実現するために、これま で開発したSTP装置の回路系をオミクロン社製のUHV-STM装置に導入し、吸着表面上での STP測定を行うべく、装置開発を進めている。当日は、開発を進めているSTP装置の性能評 価とSi清浄表面から作成された超周期構造をもつ表面の測定結果について報告する予定である。

[1] M. Hamada and Y. Hasegawa: Jpn. J. Appl. Phys. 51 (2012) 125202